

## 株式情報

平成20年3月31日現在

発行可能株式総数	102,000株
発行済株式総数	33,405株
株主数	2,719名

### ■大株主

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
株式会社エー・アンド・デイ	10,216	30.58
富加津 好夫	4,665	13.96
新田 純	830	2.48
宮内 栄	790	2.36
生江 隆男	500	1.49
富加津 英夫	500	1.49
山川 陽光	485	1.45

## 株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
売買単位	1株
株主名簿管理人	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
同事務取扱所	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 TEL：0120-78-2031（フリーダイヤル）
同取次所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店

## 会社概要

平成20年3月31日現在

会社名	株式会社ホロン（HOLON CO.,LTD.）
所在地	〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-5 新宿土地建物第11ビル3F TEL：03-3341-6431（代）
設立	昭和60年5月
資本金	6億9,236万円
代表者	穴澤 紀道
従業員数	40名
事業内容	半導体検査装置の開発、 製造、販売、保守サービス

## 役員

平成20年3月31日現在

代表取締役社長	穴澤 紀道
取締役	崎山 武美
取締役	新田 純
取締役	松方 清彦
取締役	安宅 正志
取締役	加藤 邦彦
取締役	小林 賢一
取締役相談役	富加津 好夫
常勤監査役	生江 隆男
監査役	有賀 益千代
監査役	三澤 順一

※監査役 有賀益千代及び三澤順一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

<http://www.holon-ltd.co.jp/>

**HOLON** 株式会社 **ホロン**

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-5 新宿土地建物第11ビル3F  
TEL：03-3341-6431（代）  
(JASDAQ：7748)



Business Report

Business Report

**HOLON**  
株式会社 **ホロン**

第23期 株主通信  
平成19年4月1日～平成20年3月31日



代表取締役社長  
穴澤 紀道

ホロンのものさしは  
ナノメートル。  
見えない世界を測ります。

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なご支援、ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

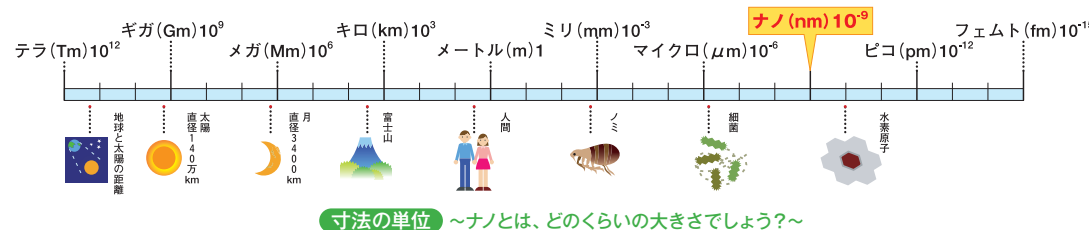
本年1月、代表取締役社長に就任いたしました穴澤紀道でございます。

当社が参画しておりますフォトマスク用CD-SEM市場は、一見小さいように見えますが、微細化技術は半導体だけでなく、MEMS（微小電気機械素子及び創製技術）をはじめとして急速に拡大しております。微細な、ナノオーダーの対象を「見る」「加工する」という手段はますます重要になると考えられ、電子ビーム技術に対する需要は絶えることがないでしょう。

しかしながら、当期における半導体産業は、デバイスメーカー、マスクメーカーの業績悪化による開発投資の先送りが目立ち、フォトマスク市場に依存する部分が多い当社にとって経営環境は一層厳しいものとなりました。次期につきましては、この業績不振を反省し、新たな製品開発と複数製品の製造・販売による経営の安定化が急務と考え、経営体制にてご入力を行っているところでございます。

当社の置かれた環境の厳しさは一朝一夕には変わりませんが、常に好奇心と飽くなき探求心を持って製品の進化・開発に努め、製品価値を高めて市場に提供し、上場企業として事業を継続発展させ、経営の安定化を図ることが株主の皆様の利益保護に繋がるものと考えております。そして、業績の回復とさらなる事業拡大を目指し、企業価値の向上及び株式価値の向上を目標に尽力していく所存です。

株主の皆様におかれましては、引き続き、より一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。



CONTENTS

株主の皆様へ	1	財務諸表(要旨)	5-6
特集 トップインタビュー	2-3	株式情報、株主メモ、会社概要、役員	裏表紙
業績報告・HISTORY	4		

当社は、去る12月11日の取締役会において、穴澤紀道が代表取締役社長に就任いたしました。今後は、新たな経営体制のもとで持続的な成長を目指し、企業価値のさらなる向上を図ります。

Q 新しい経営体制が発足しましたが、その背景と狙いについてお聞かせください。

A 市場環境が大きく変動しているなかで、当社は、より俊敏な対応とさらには柔軟性が求められています。私としましては、「スモール・カンパニーの俊敏性を活かせ」という経営方針を掲げ、企画開発から製品化までのスピードアップを図り、市場の動向に迅速に対応できる体制と、高性能化・高付加価値化を実現した商品を市場に提供できる体制の確立を目指していきます。

今まで当社は、お客様と信頼性を保ちながら、高い専門性を持って高額な装置を販売していくビジネスモデルを展開しておりました。しかし、主力製品「EMU」一本の商品構成では業績



回復は難しく、より柔軟に対応する新しい戦略が必要だと感じております。私はホロンに入社して以来、技術開発を主として取り組んでまいりましたが、その過程において他社と組んだ共同開発はあまりありませんでした。しかし、今後は株式会社エー・アンド・デイをはじめ、他社と技術開発を軸とした連携を深めていきます。すでに同社とは、技術者レベルでの検討会を数回開いています。他社との協力によって、当社の主製品の性能アップにつなげ、同時にそれぞれの技術を活かした商品開発も行っていきたいと考えています。

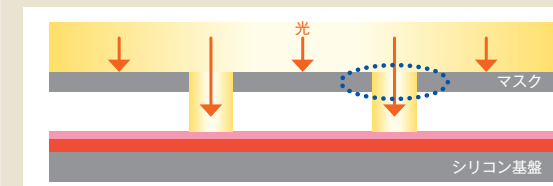
EMU-270A 微小寸法測定装置

電子ビームによりマスクの寸法が設計どおりに行われているかを測定する装置です。



EMUの測定対象

当社が最も得意とするのは、電子ビームをコントロールする技術であり、今後も当社が手がける製品は、電子ビーム技術をコアとしたものになると考えております。



**Q** 詳しい市場環境も含めて  
今後どのような事業戦略をお考えですか？

**A** 我々の業界では製品レベルではなくて開発段階から製品競争が始まります。つまり、製品レベルより1世代先で動くわけです。

業界全体として65nmから45nmへ移行する流れのなかで、半導体市況の悪化が響き、お客様の設備投資計画がずれ込んできている傾向があります。当社としては、性能面での優位性を確保しながら、いつ前倒しになっても対応できる体制にしておきたいと考えます。

このような状況下で、半導体だけでなく別の市場への取り込みを進めているのが電子スタンパー「EBLITHO」という製品です。この分野は、お客様の計画にあった装置が開発できれば、さらなる受注獲得が可能であると考えております。また、この技術はLEDだけでなく、レーザーディスクや他の光学素子への応用も視野に入りますので、新しい応用製品を積極的に開発していきたいと思っております。

■ EBLITHO LED生産用パターン転写装置



LED（発光ダイオード）市場をターゲットとし、ステンスルマスクを利用した低加速電子ビーム高速転写装置です。

**Q** 強みとそれを活かす施策について  
お聞かせください。

**A** 当社の技術者は少数だが精鋭で高い技術を持っていると自負しています。技術者がお客様の現場に出向き、直接ご要望を聞き、それに敏感に応える努力をしてくれています。当社はやはり開発型の会社であると思うのです。安定した経営ができるような製品を持ちつつ、絶えず開発を続けることが会社の活性を維持することにつながると考えます。

今は規模の大きい会社でも開発する力が衰えているのが現状だと思います。私もものづくりに関わっていますが、何かをまとめることができる人間が少なくなっている気がしています。開発は製品の様々な知識がないと難しい部分があります。組み合わせたときにどうなるかということが分かるためには、各部分のことが理解できていなくてはなりません。また、それだけではなく、もうひとつ何かキーポイントを作ることができるかどうか大切だと思います。例えば商品の特徴を作るとか、技術的に突出するとかということですね。

当社の強みである技術力と開発力があれば、開発面で他社と役割を分担していくことが可能ですし、今後はこれが主流になるのではないかと考えます。今までの概念にとらわれずにビジネスチャンスに対して積極的に取り組むことで、企業価値を高めていけるよう努めてまいります。



当期の概況

当社の参画しております半導体業界は、大手デバイスメーカーの設備投資の先送りなど装置産業を牽引する半導体産業での低迷が見られました。

このような状況のもと、当社の主力製品であるフォトマスク用寸法測定装置「EMU」は、測定対象が最先端の45-32nmノード対応の要求を受けて開発を進め、半導体デバイスメーカー及びマスクメーカーの評価を受けてまいりました。しかしながら、45nmノードの開発投資はデバイスメーカー、マスクメーカーともに業績悪化から依然抑えられており、当社は、当初計画した経営成績を達成することができませんでした。

また、シリコンサイクルによる影響を少なくし事業の多角化を構築する目的で投入したLED（発光ダイオード）生産用パターン転写装置である電子スタンパー「EBLITHO」は、活発な開発競争で設備投資が盛んなLED素子量産向けの装置であります。周辺技術開発の遅れから当初の予定を下回り、LEDメーカーへ1台納入するに止まりました。

上記の結果、当期の売上高は306百万円（前期比46.0%減）、営業損失は326百万円（前期営業損失400百万円）、経常損失は343百万円（前期経常損失396百万円）、当期純損失は409百万円（前期当期純損失398百万円）となりました。

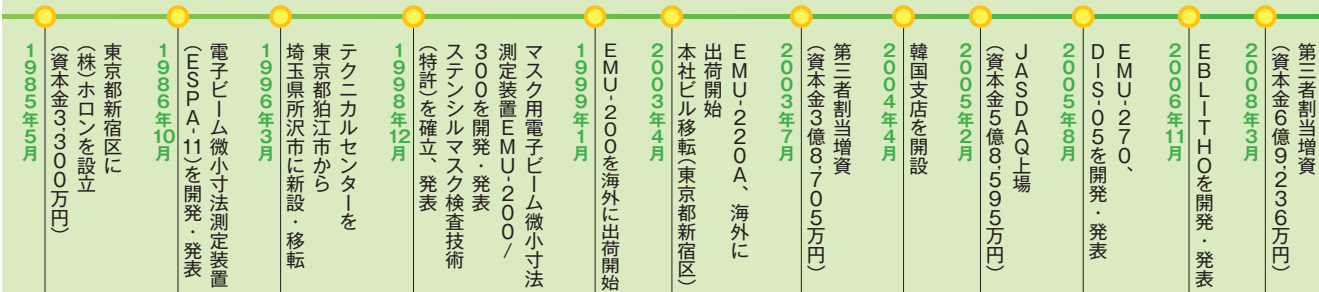
次期業績予想

半導体の最先端製品である45nmノード製品は、Windows-Vistaに代表されるように販売の伸び悩み現象があり、そのあおりを受けてフォトマスクの受注量も減少傾向にあると考えられます。次期におきまして、前半は上記の影響から様子見がなされるものの、下期からPND（簡易型ポータブルナビゲーションシステム）や薄型TVの回復が予想され、国内、米国、台湾、韓国など近隣諸国のデバイスメーカー及びマスクメーカーから、最先端製品開発用装置への要求が活発化されると考えております。

当社は、平成20年3月10日実行の第三者割当増資により調達した資金を試験研究開発へ投資し、製品開発を推進することで主力製品「EMU」の製品性能アップを図り高性能化・高付加価値化を実現して商品力を強化し、順延している商談の早期成立を目指しております。また、電子スタンパー「EBLITHO」では新たにレジストメーカーとの共同開発をスタートさせ、顧客のニーズに合った製品を開発し受注獲得に結びつけたいと考えております。

次期の業績見通しにつきましては、売上高870百万円、営業利益13百万円、経常利益14百万円、当期純利益12百万円を見込んでおります。

HISTORY



貸借対照表

単位：百万円、単位未満切捨

科 目	前期(第22期) 平成19年3月31日現在	当期(第23期) 平成20年3月31日現在	科 目	前期(第22期) 平成19年3月31日現在	当期(第23期) 平成20年3月31日現在
<b>■ 資産の部</b>			<b>■ 負債の部</b>		
流動資産	1,504	1,191	流動負債	325	128
現金及び預金	410	210	固定負債	240	94
受取手形	5	6	<b>負債合計</b>	<b>566</b>	<b>223</b>
売掛金	262	58	<b>■ 純資産の部</b>		
有価証券	215	280	株主資本	1,319	1,114
その他	611	635	資本金	589	692
貸倒引当金	△1	—	資本剰余金	533	635
固定資産	381	146	利益剰余金	196	△213
有形固定資産	272	94	<b>純資産合計</b>	<b>1,319</b>	<b>1,114</b>
無形固定資産	42	—	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,885</b>	<b>1,337</b>
投資その他の資産	65	51			
<b>資産合計</b>	<b>1,885</b>	<b>1,337</b>			

損益計算書

単位：百万円、単位未満切捨

科 目	前期(第22期) 平成18年4月1日～ 平成19年3月31日	当期(第23期) 平成19年4月1日～ 平成20年3月31日
売上高	566	306
売上原価	385	191
売上総利益	180	115
販売費及び一般管理費	581	441
営業損失	400	326
営業外収益	7	1
営業外費用	3	18
経常損失	396	343
特別利益	1	145
特別損失	0	209
税引前当期純損失	395	407
法人税、住民税及び事業税	3	1
当期純損失	398	409

キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円、単位未満切捨

科 目	前期(第22期) 平成18年4月1日～ 平成19年3月31日	当期(第23期) 平成19年4月1日～ 平成20年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	△452	△206
投資活動によるキャッシュ・フロー	△79	△10
財務活動によるキャッシュ・フロー	7	90
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△7
現金及び現金同等物の増減額	△523	△134
現金及び現金同等物の期首残高	1,149	625
現金及び現金同等物の期末残高	625	491

株主資本等変動計算書 (平成19年4月1日～平成20年3月31日まで)

単位：百万円、単位未満切捨

	株 主 資 本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	
平成19年3月31日残高	589	533	196	1,319	1,319
事業年度中の変動額					
新株の発行	102	102	—	205	205
当期純損失	—	—	△409	△409	△409
事業年度中の変動額合計	102	102	△409	△204	△204
平成20年3月31日残高	692	635	△213	1,114	1,114